

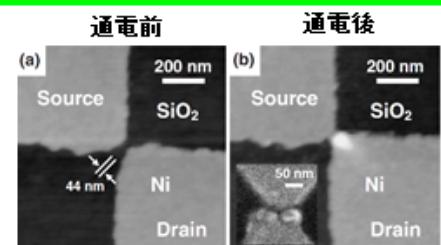
研究タイトル: 原子の移動制御手法を用いたナノギャップデバイスの開発



氏名:	伊藤 光樹 / Mitsuki ITO	E-mail:	m-ito@kushiro-ct.ac.jp
職名:	助教	学位:	博士(工学)
所属学会・協会:	応用物理学会		
キーワード:	ナノギャップ, ナノエレクトロニクス, エレクトロマイグレーション		
技術相談 提供可能技術:	<ul style="list-style-type: none"> ・微小電流測定 ・デバイス作製プロセス 		

研究内容:

電界放射電流誘起型EM: アクティベーション法



通電を用いたナノギャップ型トンネルデバイスの作製手法
→ 従来までの手法と比較して簡潔・容易

1. 単電子トランジスタ(Single-Electron Transistors: SETs)の作製

W. Kume, Y. Tomoda, M. Hanada, and J. Shirakashi, *J. Nanosci. Nanotechnol.* 10 (2010) 7239.
M. Ito, M. Yagi and J. Shirakashi, *AIP Advances* 8 (2018) 075210.

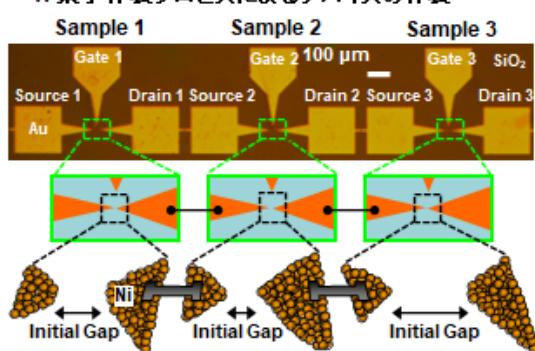
2. Ni/Vacuum/Niからなる不揮発性抵抗変化型メモリの検討

T. Toyonaka, K. Morihara, K. Takikawa, M. Ito and J. Shirakashi, *J. Vac. Sci. Technol. B*, 33 (2015) 02B107.

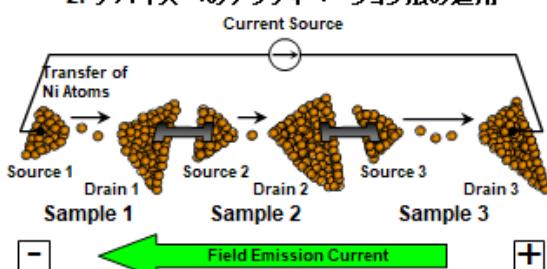
S. Kayashima, K. Takahashi, M. Motoyama, and J. Shirakashi, *Jpn. J. Appl. Phys., Part 2* 46, L907 (2007).

アクティベーション法によるナノスケールデバイスの集積化

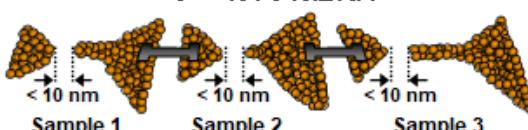
1. 素子作製プロセスによるデバイスの作製



2. デバイスへのアクティベーション法の適用



3. デバイスの特性制御



M. Ito, M. Yagi, K. Morihara and J. Shirakashi, *J. Appl. Phys.* 118 (2015) 014301.

提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)
